

УДК 537.533

К ТЕОРИИ ЖЕЛОБКОВОЙ И ТОКОВО-КОНВЕКТИВНОЙ НЕУСТОЙЧИВОСТЕЙ В ПЛАЗМЕННОМ СЛОЕ, УДЕРЖИВАЕМОМ МАГНИТНЫМ ПОЛЕМ

Е. Абу-Ассали, А. А. Рухадзе, Б. Шокри

Исследованы желобковая и токово-конвективная неустойчивости замагниченного плазменного слоя в условиях, когда размер неоднородности плотности вблизи поверхности слоя много меньше неоднородности поля (модель резкой границы) и приближение геометрической оптики не применимо. Рассмотрены случаи толстого по сравнению с неоднородностью поля и тонкого слоев плазмы, и полученные инкременты развития неустойчивостей сравниваются с найденными в рамках геометрической оптики.

1. В [1] изложен общий способ анализа устойчивости произвольно неоднородной плазмы, удерживаемой сильным магнитным полем, когда поле колебаний можно считать потенциальным. Однако конкретный анализ для интересующих нас неустойчивостей приведен лишь в пределе коротковолновых колебаний, описываемых в рамках приближения геометрической оптики. Длинноволновые колебания, с длиной волны больше размера неоднородности плазмы, удерживаемой магнитным полем, были рассмотрены в недавних работах [2, 3], но при этом изучались лишь колебания бестоковых плазменных слоев, в которых интересующие нас неустойчивости развиваться не могут. В этих работах изучались только медленные неустойчивости, обусловленные ларморовским дрейфом заряженных частиц.

Вместе с тем, хорошо известно, что при наличии реального дрейфа носителей заряда, обусловленного кривизной силовых линий магнитного поля (гравитационный дрейф), либо продольным дрейфом электронов (ток в плазме), в системе возможно развитие быстрых неустойчивостей, с фазовой скоростью много больше тепловых скоростей частиц

и даже самих скоростей дрейфа. Это хорошо известные желобковая (или гравитационная) и токово-конвективная неустойчивости, спектр которых для случая бесстолкновительной плазмы в приближении геометрической оптики дается соотношением

$$\omega^2 = -\frac{k_y(\mathbf{k}\mathbf{u})\Omega_i}{k^2} \frac{\partial \ln N}{\partial x} + \frac{k_z^2}{k^2} \frac{M}{m} \Omega_i^2. \quad (1)$$

Здесь $\mathbf{u} = \mathbf{u}_e - \mathbf{u}_i$ – относительная скорость объемного дрейфа электронов и ионов, k_z и k_y – продольное и азимутальное волновые числа колебаний с частотой ω , причем считается, что магнитное поле \mathbf{B}_0 направлено вдоль оси OZ , а плазма неоднородна вдоль оси OX , $\Omega_i = eB_0/Mc$ – ионная ларморовская частота. При получении (1) предполагалось, что $k_y \gg k_z$, $|\frac{\partial \ln N}{\partial x}|$, а поэтому $k^2 \approx k_y^2 + k_z^2 + (\partial \ln N / \partial x)^2 \approx k_y^2$, плазма считается достаточно плотной, $\omega_{Li}^2 = 4\pi e^2 N / M \gg \Omega_i^2$. Последнее неравенство для простоты считается выполненным и ниже.

Если дрейф носителей заряда обусловлен кривизной силовых линий магнитного поля, то [1]

$$\mathbf{u} \parallel OY, u = +\frac{v_{Ti}^2 + v_s^2}{R\Omega_i} \equiv +\frac{g_{eff}}{\Omega_i}, \quad (2)$$

где $v_{Ti} = \sqrt{T_i/M}$, $v_s = \sqrt{T_e/M}$. Величину g_{eff} часто называют гравитационным ускорением частиц, обусловленным кривизной магнитного поля R . В этом случае

$$\omega^2 = g_{eff} \frac{\partial \ln N}{\partial x} + \frac{k_z^2}{k_y^2} \frac{M}{m} \Omega_i^2. \quad (3)$$

Видно, что колебания могут быть неустойчивыми, если $\partial \ln N / \partial x < 0$ (кривизна и неоднородность противоположны), причем конечное продольное волновое число стабилизирует неустойчивость. В пределе $k_z = 0$ эта неустойчивость известна как желобковая.

Весьма близкую природу имеет и так называемая токово-конвективная неустойчивость, обусловленная продольным токовым дрейфом электронов, т.е. $\mathbf{u}_e = \mathbf{u} \parallel OZ$, $\mathbf{u}_i = 0$. В этом случае из (1) следует [1]

$$\omega^2 = -\frac{k_z u}{k_y} \Omega_i \frac{\partial \ln N}{\partial x} + \frac{k_z^2}{k_y^2} \frac{M}{m} \Omega_i^2. \quad (4)$$

Видно, что неустойчивость может иметь место при $k_z \neq 0$ и любом знаке $\partial \ln N / \partial x$, но с ростом k_z происходит стабилизация неустойчивости.

2. Все приведенные выше результаты заимствованы из [1] и даются для сравнения. Ниже они обобщаются на случай плазменного слоя конечной толщины a и длинноволновых колебаний с длиной волны больше неоднородности границы плазмы. Как уже отмечалось выше, общее дисперсионное уравнение для колебаний плазменного слоя, удерживаемого магнитным полем, было получено в работах [2, 3], в которых, однако, реальный дрейф носителей заряда не учитывался. Учет такого дрейфа приводит к тому же по виду уравнению

$$[(1 + \beta)^2 \kappa^2 + k_y^2 + k_z^2 - \gamma^2] \tanh(\kappa a) + 2\kappa(1 + \beta) \sqrt{k_y^2 + k_z^2} = 0, \quad (5)$$

но с видоизмененными величинами

$$\beta = \sum_{\alpha=e,i} \frac{\omega_{L\alpha}^2}{\Omega_\alpha^2} I_+ \left(\frac{\omega - \mathbf{k}\mathbf{u}_\alpha}{k_z v_{T\alpha}} \right), \quad \gamma = \sum_{\alpha=e,i} \frac{\omega_{L\alpha}^2 k_y}{\Omega_\alpha (\omega - \mathbf{k}\mathbf{u}_\alpha)} I_+ \left(\frac{\omega - \mathbf{k}\mathbf{u}_\alpha}{k_z v_{T\alpha}} \right),$$

$$\kappa^2 = k_y^2 + \frac{1}{1 + \beta} \left\{ k_z^2 + \sum_{\alpha=e,i} \frac{\omega_{L\alpha}^2}{v_{T\alpha}^2} \left[1 - I_+ \left(\frac{\omega - \mathbf{k}\mathbf{u}_\alpha}{k_z v_{T\alpha}} \right) \right] \right\}, \quad I_+(x) = x e^{-x^2/2} \int_{i\infty}^x e^{\tau^2/2} d\tau, \quad (6)$$

которые теперь включают скорости дрейфа носителей $\mathbf{u}_\alpha = \mathbf{u}_{e,i}$; все обозначения совпадают с использованными в [1].

Величина $|\kappa|^{-1}$ представляет собой глубину проникновения поля в плазменный слой. Поэтому в пределе $a|\kappa| \gg 1$, как и следовало ожидать, из (1) следует уравнение для поверхностной волны для полуограниченной плазмы (на двух поверхностях слоя)

$$(1 + \beta)\kappa + \sqrt{k_y^2 + k_z^2} \pm \gamma = 0. \quad (7)$$

В этом случае, очевидно, должно выполняться условие $\kappa^2 > 0$.

Уравнение (7) содержит нечетную по k_y функцию $\gamma(k_y)$, что свидетельствует об однонаправленности волн на каждой из поверхностей плазменного слоя. С уменьшением толщины слоя a такая однонаправленность ослабевает, а в пределе тонкого слоя, $a|\kappa| \ll 1$, полностью исчезает. В этом пределе уравнение (5) принимает вид [2, 3]

$$(1 + \beta)^2 \kappa^2 + k_y^2 + k_z^2 - \gamma^2 + 2 \frac{1 + \beta}{a} \sqrt{k_y^2 + k_z^2} = 0. \quad (8)$$

Это уравнение, в отличие от (7), является четной функцией k_y . Это означает, что в рассматриваемом пределе две поверхностные волны на противоположных поверхностях

слоя сливаются в одну, вследствие чего их однонаправленность исчезает. В следующем порядке по $a|\kappa| \ll 1$ она слабо проявится¹.

3. Уравнения (7) и (8) в отсутствие объемного дрейфа носителей анализировались в работах [2, 3], где было показано, что неустойчивые решения существуют только в области малых фазовых скоростей, меньших тепловых скоростей частиц. При наличии сколь угодно малого объемного дрейфа носителей появляются неустойчивости и при полном пренебрежении тепловым движением, обобщающие решения (1), (3) и (4), справедливые в пределе геометрической оптики. Как и выше, мы здесь приведем такие решения, считая $k_y^2 \gg k_z^2$, $\omega_{Li}^2 \gg \Omega_i^2$.

Из уравнения (7) находим спектр поверхностных волн на поверхностях "толстого" ($|k_y|a \gg 1$) слоя в условиях, когда их фазовая скорость больше как тепловых скоростей, так и скоростей дрейфа носителей (ср. с (1)):

$$\omega^2 = \pm \frac{k_y}{|k_y|} (\mathbf{k}\mathbf{u}) \Omega_i + \frac{1}{2} \frac{k_z^2}{k_y^2} \frac{M}{m} \Omega_i^2. \quad (9)$$

В случае, когда объемный дрейф носителей определяется кривизной силовых линий магнитного поля, из формул (2) и (9) следует

$$\omega^2 = \pm |k_y| g_{eff} + \frac{1}{2} \frac{k_z^2}{k_y^2} \frac{M}{m} \Omega_i^2. \quad (10)$$

Сравнивая это с (3), видим, что вместо характерного размера неоднородности плазмы $L_0^{-1} \sim \left| \frac{\partial}{\partial x} \ln N \right|$ в (10) фигурирует k_y . Видно, что неустойчива лишь одна из поверхностных волн, для которой кривизна положительна. Кроме того, конечное значение продольного волнового числа k_z , как и в случае (3), играет стабилизирующую роль. Поскольку в приближении геометрической оптики считалось $k_y L_0 \gg 1$, то заключаем, что инкремент желобковой неустойчивости (10) (при $k_z \rightarrow 0$) больше чем (3), т.е. длинноволновая мода нарастает быстрее коротковолновой.

Аналогичная ситуация имеет место и для плазмы с током, т.е. когда $\mathbf{u}_e = \mathbf{u} \parallel OZ$, $\mathbf{u}_i = 0$. Формула (9) при этом дает

$$\omega^2 = \pm \frac{k_y k_z u}{|k_y|} \Omega_i + \frac{1}{2} \frac{k_z^2}{k_y^2} \frac{M}{m} \Omega_i^2. \quad (11)$$

¹Здесь мы не говорим об однонаправленности вдоль оси OZ, являющейся проявлением эффекта Доплера $\omega \rightarrow \omega - \mathbf{k}\mathbf{u}_\alpha$.

Здесь также происходит замена $L_0^{-1} \sim |\frac{\partial \ln N}{\partial x}| \rightarrow k_y$, причем, с ростом k_z неустойчивость стабилизируется, неустойчивы только сильно вытянутые вдоль магнитного поля винтовые возмущения. Кроме того, поскольку $k_y L_0 \gg 1$, мы опять заключаем, что длинноволновые моды обладают большим инкрементом, чем коротковолновые.

4. Рассмотрим теперь предел тонкого ($|k_y|a \ll 1$) плазменного слоя и проанализируем решения уравнения (8), считая $k_y^2 \gg k_z^2$ и $\omega_{Li}^2 \gg \Omega_i^2$. В результате это уравнение сводится к виду

$$\left(1 + \frac{2}{|k_y|a} \frac{\Omega_i^2}{\omega_{Li}^2}\right) \omega^4 - \frac{k_z^2 M}{k_y^2 m} \Omega_i^2 \omega^2 - (\mathbf{k}u)^2 \Omega_i^2 = 0. \quad (12)$$

Один из корней этого уравнения соответствует неустойчивым колебаниям, и их спектр дается соотношением

$$\omega^2 = \left[2 \left(1 + \frac{2}{|k_y|a} \frac{\Omega_i^2}{\omega_{Li}^2}\right)\right]^{-1} \left[\frac{k_z^2 M}{k_y^2 m} \Omega_i^2 - \sqrt{\frac{k_z^4 M^2}{k_y^4 m^2} \Omega_i^4 + 4 \left(1 + \frac{2}{|k_y|a} \frac{\Omega_i^2}{\omega_{Li}^2}\right) \Omega_i^2 (\mathbf{k}u)^2}\right]. \quad (13)$$

Выражение (13) сильно упрощается для желобковой ($k_z \rightarrow 0$) моды колебаний, когда оно принимает вид

$$\omega^2 = -k_y g_{eff} \left(1 + \frac{2}{|k_y|a} \frac{\Omega_i^2}{\omega_{Li}^2}\right)^{-1/2}. \quad (14)$$

Сравнивая (14) с (10), видим, что в тонком плазменном слое инкремент нарастания желобковой моды уменьшается по сравнению с инкрементом нарастания поверхностной моды с $k_z = 0$ и становится зависящим от толщины слоя, если $|k_y|a \gtrsim 2\Omega_i^2/\omega_{Li}^2 \gg 1$.

Что касается токово-конвективной неустойчивости в токовой плазме, то инкремент ее нарастания (13) для тонкого слоя можно представить простым выражением в противоположных предельных случаях:

$$\omega^2 = \begin{cases} -\omega_0 k_z u \text{ при } \omega^2 > \frac{k_z^2 M}{k_y^2 m} \omega_0^2 \equiv \frac{k_z^2 M}{k_y^2 m} \Omega_i^2 \left(1 + \frac{2\Omega_i^2}{|k_y|a \omega_{Li}^2}\right)^{-1} \\ -\frac{m}{M} k_y^2 u^2 \text{ при } \omega^2 < \frac{k_z^2 M}{k_y^2 m} \omega_0^2. \end{cases} \quad (15)$$

Здесь также мы видим уменьшение инкремента нарастания токово-конвективной неустойчивости в тонком слое плазмы по сравнению с инкрементом нарастания поверхностной моды этой же неустойчивости в "толстом" слое.

5. В заключение кратко обсудим возможность проявления рассмотренной выше токово-конвективной неустойчивости в экспериментах [4]. Именно с целью объяснения

этих экспериментов были выполнены работы [2, 3]. Напомним, что в экспериментах [4] создавался тонкий плазменный слой с толщиной $\Delta_p \lesssim 1$ мм низковольтным электронным пучком (с энергией $\lesssim 1$ кэВ и плотностью $n_b \approx 10^{11}$ см⁻³) в тяжелом газе с $M \approx 200 \cdot 10^{-24}$ г (ксенон) при давлении $P_0 \simeq 10^{-3}$ торр. Средний радиус пучка, а следовательно, и плазменного слоя составлял $r_p \simeq 1$ см, т.е. $r_p \gg \Delta_p$ и слой можно считать плоским. Газ ионизовался в течение десятков микросекунд до полной ионизации ($N_{max} \lesssim 10^{13}$ см⁻³), после чего пучок выключался и плазма распадалась также в течение десятков микросекунд. Вся система помещена в сильное продольное магнитное поле с напряженностью в 20 кГс, причем длина системы $L_{||} \simeq 25$ см.

В работах [2, 3] наблюдаемая в экспериментах [4] азимутальная неоднородность плазменного слоя объясняется развитием дрейфовой неустойчивости на стадии распадающейся бестоковой плазмы. Несмотря на вполне убедительное согласие теоретических оценок с результатами эксперимента, не лишено смысла выяснить, не могла ли развиться токово-конвективная неустойчивость в слое на стадии образования плазмы, когда в ней протекал пучковый ток. Чтобы ответить на этот вопрос напомним, что токово-конвективная неустойчивость развивается в условиях

$$\Omega_i^2 \gg \omega^2 \gg (k_z u)^2, k_z^2 v_{Te}^2, \nu_e^2. \quad (16)$$

В экспериментах [4] $k_{zmin} \simeq \pi/L_{||} \simeq 10^{-1}$ см⁻¹, а $u \simeq 10^9$ см/с, $\Omega_i \simeq 2 \cdot 10^6$ с⁻¹. Поэтому очевидно, что $k_z u \simeq 10^8$ с⁻¹ и неравенство $\Omega_i > k_z u_i$ заведомо не выполняется. Следовательно, развития токово-конвективной неустойчивости на стадии создания плазмы ожидать не следует, и остается только объяснение, данное в работах [2, 3]. Вместе с тем, отметим что с переходом к более сильным магнитным полям (до 50 кГс) и длинным системам (до $L_{||} \gtrsim 100$ см), к чему стремится современная релятивистская плазменная СВЧ электроника, опасность развития токово-конвективной неустойчивости станет реальной.

ЛИТЕРАТУРА

- [1] Александров А. Ф., Богданкевич Л. С., Рухадзе А. А. Основы электродинамики, М., Высшая школа, 1988 г.
- [2] Кринецкий В. Б., Рухадзе А. А., Шокри Б. Краткие сообщения по физике ФИАН, N 11 – 12, 38 (1995).
- [3] R u k h a d z e A. A. and S h o k r i B. Phys. Letters A, 1997 (in press).

- [4] Лоза О. Т., Пономарев А., Ульянов Д. К. и др. Физика плазмы, **23**, 222 (1997).

Институт общей физики РАН

Поступила в редакцию 3 июня 1997 г.